貴金属ナノ粒子のボトムアップレーザプロセッシング技術の開発

大阪大学 大学院工学研究科 精密科学・応用物理学専攻 助教 吉川裕之 (平成21年度一般研究開発助成AF-2009216)

キーワード:銀ナノ粒子,光捕捉,表面増強ラマン散乱

研究の目的と背景

近年、金、銀、白金などの貴金属ナノ粒子の光学特性や触媒 作用などが注目されている。例えば金や銀ナノ粒子は局在表面 プラズモン共鳴と呼ばれる特有の光学特性を示し、高感度分光 分析やバイオセンシングなどへの応用が期待される。金や白金 ナノ粒子は述ルクに比べ著しく高い触媒活性を持つ。これらナ ノ粒子は通常、担体や基板に固定化して用いられる。これまで にも、化学合成や蒸着法で担体や基板上に直接ナノ粒子を形成 させる方法や、コロイド状のナノ粒子を基板上にコートして溶 媒を蒸発させる手法などが開発されてきた。しかし、これら従 来法では貴金属ナノ粒子の配列構造や任意のパターンを作製す ることが難しく、次世代産業を担うマイクロチップやナノデバ イスにナノ粒子の機能を組み込むためには新技術の創成が必要 である。

そこで本研究では貴金属ナノ粒子のコロイド溶液中に近赤外 レーザ光を集光し、光の"力"で集光点に形成されるナノ粒子 集合体を、基板上の任意の場所に固定化する新しいレーザプロ セッシング技術の開発に取り組んだ。集光レーザスポットにコ ロイド粒子を捕捉する光捕捉法(レーザピンセットとも呼ばれ る)は、従来マイクロメートルサイズの粒子を一粒づつ液中で 操作するために用いられてきたが、本手法は複数個の貴金属ナ ノ粒子を集光スポット内に捕捉し、基板上の任意の位置に固定 化・パターニングする。レーザによる金属ナノ加工技術として は、パルスレーザの高いエネルギーを利用して金属表面を局所 的にアブレーションするトップダウン型レーザプロッセッシン グ技術が盛んに研究されているが、本研究では比較的弱い連続 発振レーザを利用することにより、局在プラズモン共鳴に起因 する高い光機能性を保ったまま基板上にナノ粒子集合体を配列 させるボトムアップレーザプロセッシングを実現した。さらに、 可視集光レーザを利用して銀イオンの還元を局所的に誘起し、 銀ナノ粒子集合体を基板上にパターニングする手法についても 研究を行った。

基板上に固定化した貴金属ナノ粒子配列構造に期待される光 機能性は、照射光エネルギーをナノ粒子近傍に局在化させる光 電場増強である。この光増強場が分子のラマン散乱を10桁以上 増強する表面増強ラマン散乱(Surface Enhanced Raman Scattering: SERS)は、一分子分析を可能にする画期的分子分 光法として非常に注目されている¹⁾。本研究では基板上にパター ニングされた銀ナノ粒子集合体からの表面増強ラマン散乱と局 在プラズモン共鳴の関係について調べ、光電場増強の解析にも 取り組んだ。

2. 実験システムの構築

今回構築した実験システムの概略を図1に示す。倒立型光学 顕微鏡(OLYMPUS IX-70)にレーザ光を導入して100倍または60 倍の対物レンズで集光する。レーザ光源は波長1064nmの近赤外 レーザと、波長532nm または633nmの可視レーザを用いた。い ずれも連続発振で近赤外レーザはナノ粒子の光捕捉に、可視レ ーザはラマン散乱や光化学反応を誘起するために用いた。光路 上に配置したメカニカルシャッターと、顕微鏡の電動ステージ を、データ収集システム(ナショナルインスツルメンツ: USB-6009)とPCのシリアルポートを介して動作させ、各レーザ 照射のタイミングや時間、集光位置を制御した。集光位置から のレイリー散乱光やラマン散乱光を、顕微鏡のサイドポートに 接続した光ファイバを通して光電子増倍管や分光器に導入し、 強度やスペクトルを測定した。



3. 光捕捉による銀ナノ粒子集合体のガラス基板上への 配列固定化

スライドガラスとカバーガラスの間にシリコンゴムで 100 ミ クロンの隙間を作り、そこにクエン酸還元法で作製した銀コロ イド溶液 (平均粒径 50 nm)を注入して実験を行った図2(a, b)。 対物レンズを出たレーザ光はカバーガラス側から導入され、ス ライドガラスとコロイド溶液の界面付近に集光される。自作の プログラムによって電動ステージとメカニカルシャッターを制 御し、各点に一定時間レーザを照射して配列構造を作製した。



図2(a, b)実験の概略図(c)レーザ集光点の配置(d)開口数 1.3 および(e)0.7の実験条件で作製した銀ナノ粒子集合体の暗 視野光学顕微鏡像

図 2(c)にレーザ照射点の座標を示す。各レーザ照射点の間隔 はおよそ2ミクロンで、約12ミクロン四方の"光"の文字が 描かれる。今回は各点に10秒間レーザ照射を行った。

図 2(d) に強度約 24 nW、スポット径約 500nm の集光レーザで 配列固定化した後の暗視野顕微鏡像を示す。銀ナノ粒子は固定 化されているが、レーザ照射位置から1 ミクロン以上離れた点 にも粒子が吸着する場合があり、得られたパターンも不明瞭に なっている。実際にレーザの照射開始とともに銀ナノ粒子の光 捕捉はされるが、ガラス基板上に固定化されにくく、レーザ照 射を止めると多くの粒子が集光位置から離れていく様子が観察 された。集光角が大きいほど光捕捉力は強くなるため、通常、

開口数(Numerical Aperture: N.A.)の大きな対物レンズが用 いられる。本研究でも開口数 1.3 の油浸対物レンズを用いた。 使用した対物レンズは開口数を変えることが出来、図 2(e)は開 口数を 0.7 程度に絞った条件で作製したパターンの暗視野像で ある。対物レンズの開口が絞られた結果、レーザ強度は約 13 mW に減少し、集光スポット径は約 930nm に広がる。しかしこの場 合、集光点から1ミクロン以下の領域内に精度よくナノ粒子が 固定され、より正確なパターニングが可能であった。また、個々 の銀ナノ粒子は固定化後も赤、青、緑などの明瞭な色を持って おり、局在表面プラズモン特性を損なうことなく、基板上に固 定化することができた。

このように、開口数が小さい場合の方が、より高い精度で銀 ナノ粒子を固定できるという、予想しなかった結果が得られた。 前述のように、理論的には開口数が大きな方が、集光スポット 径が小さく強度が高いため、より狭い領域にナノ粒子が強く捕 捉される。この一見矛盾する実験結果について考察する。

図3に示すように、集光レーザによって微粒子が感じる力は、 レーザ強度の高い場所へ粒子が引き寄せられる光勾配力と、レ ーザ光の進行方向に微粒子が押される光散乱力に分けることが できる。集光スポットに微粒子を捕捉するためには勾配力が散 乱力を大きく上回る必要がある。そのため、光捕捉には光を強 く集光して勾配力を大きくするため、大きな開口数の対物レン ズが用いられる。反対に開口数が小さくなると、散乱力が強く なり、粒子は光の進行方向へ押し出される。



図3 レーザ集光点でコロイド粒子に働く勾配力と散乱力

本研究ではガラス基板表面近傍で銀ナノ粒子を光捕捉し、ガ ラス基板上へ物理的に吸着させている。水中では銀ナノ粒子表 面、ガラス基板表面ともに負に帯電している²。このため、ガラ ス基板に銀ナノ粒子を吸着させるためには、この電気二重層斥 力に逆らって基板上に粒子を押し付ける必要がある。光捕捉力 の強い、開口数の大きな実験条件よりも、開口数の小さい場合 の方が高精度に粒子を配列固定化できたのは、後者の方が光散 乱力が大きく、基板上に強く銀ナノ粒子を押し付けることがで きるためであると考えられる。

このように光捕捉による銀ナノ粒子の配列固定化に対する新 たな知見が見出されたが、同時に、本研究で当初目標の一つと していた、集光スポット内に形成される一次元銀ナノ粒子配列 構造の固定化が難しいことも明らかになった。我々がすでに確 かめている集光スポット内での配列構造形成は、開口数の大き なレンズで銀ナノ粒子を強く集光スポット内に閉じ込めること によって起こる銀ナノ粒子間相互作用に起因する自己組織化的 現象である³⁰。開口数が小さく、散乱力の強い実験条件では、弱 い粒子間相互作用が乱され、レーザの偏光方向に並んだ1次元 配列構造を形成することが出来ない。この問題の解決策として は、開口数の大きな条件で集光スポット内に形成される銀ナノ 粒子配列構造に対し、第二のパルスレーザを小さな開口数で集 光して瞬間的に基板上へ転写する手法などが考えられる。もう 一つの問題点としては、物理吸着を利用する限り、レーザ集光 点以外の場所への銀ナノ粒子の自然吸着は避けられないという ことである。したがって、ガラス基板上への物理吸着による固 定化ではなく、基板表面の機能化や光化学反応を利用すること により、銀ナノ粒子を固定化する新手法の検討も重要である。 このような観点から、集光レーザを利用して溶液中で光反応を 誘起し、集光点でのみ銀ナノ粒子を形成させ、それを基板上へ 固定化する新手法について検討した。

4. 有機分子による硝酸銀の還元反応を利用した銀ナノ 粒子のレーザデポジション

一般的に銀ナノ粒子は硝酸銀水溶液をクエン酸などで還元す ることにより得られる。中性、室温の条件では反応はほとんど 進行しないが、近年、可視レーザ光を集光することにより、集 光点でのみ反応が起こり、銀ナノ粒子が析出する現象が報告さ れている⁴。しかし、吸収のない可視光により還元反応が誘起さ れるメカニズムや、高度なナノ粒子配列構造作製に関する報告 は少ない。本研究ではレーザ強度や硝酸銀濃度による集合構造 の制御や、光放射圧が集合構造に与える影響について調べた⁵。



図4 集光レーザによる銀ナノ粒子集合体の配列固定化

図4は0.5mMの硝酸銀水溶液に還元剤としてグルコースを30 mM加えた溶液をガラス基板上に滴下し、波長532nmのレーザ光 を集光して作製した配列構造である。400kW/cm²のレーザ光を各 点に0.2秒間照射することにより、ガラス基板上のレーザ集光 位置に正確に銀ナノ粒子が形成されている。興味深いことに、 図4(c)の電子顕微鏡像から、各点に形成された銀ナノ粒子集合 体は、中心に穴の開いたドーナツ状構造をしていることが分か る。中央の穴の大きさはレーザ集光スポット径とほぼ一致する。



図 5 集光点に形成される銀ナノ粒子集合体のレーザ強度依存 性。グルコース濃度は2.5 mM

図5はグルコース濃度とレーザ強度を先ほどよりも下げた条件で集光点に形成された銀ナノ粒子集合構造である。これらの結果から、レーザ強度やグルコース濃度が低いと図5(a)、集光点にのみ銀ナノ粒子集合体が形成されるが、レーザ強度等が高くなり、銀ナノ粒子が析出しやすい条件になると図5(c)のように集光スポット周囲を取り巻くドーナツ状に銀ナノ粒子が析出し始めることが分かる。





このようなドーナツ状構造は図 6 のようなメカニズムで形成 されると考えられる。レーザ照射により硝酸銀の還元反応が誘 起されると、銀ナノ粒子が析出する。レーザ強度分布はガウス 型形状であるため、レーザ強度が高い中央部ほどより早く、大 きなナノ粒子が形成される。ナノ粒子のサイズが大きくなると、 光散乱力が強くなり、中心付近の成長した粒子は光の進行方向 に押し出され、ドーナツ状の集合体が形成される。



図7 銀ナノ粒子集合体形成速度とレーザ強度の関係

さらにレーザ照射による硝酸銀還元反応メカニズムを考察す るため、ナノ粒子ができるまでの時間とレーザ強度の関係につ いて調べた。ナノ粒子が集光点に形成されると、レーザ光が散 乱され、光の波長よりもナノ粒子が小さい場合、その強度は粒 子体積の2乗に比例する。したがって、レーザの後方散乱光強 度の時間変化を検出することにより、ナノ粒子の形成、成長を モニターできる。図7(a)は、ある一定の後方散乱光強度に達す るまでの時間、すなわちレーザ照射を開始してから銀ナノ粒子 がある大きさに成長するまでの時間(t)およびその逆数(1/t) を、レーザ強度の関数としてプロットしたグラフである。レー ザ強度の増加とともに、短時間で銀ナノ粒子が形成されること を示している。図7(b)の縦軸1/rは、ナノ粒子の成長速度や硝酸 銀の還元反応速度に対応すると考えられ、レーザ強度に対して ほぼ比例関係にあることが分かる。レーザ光によって水分子や グルコースから硝酸銀への電子移動が起こり、還元される場合、 溶液は波長532nmの照射レーザ波長に対して光吸収がないため、 多光子吸収過程を経なければならない。しかし、反応が多光子 吸収に起因する場合には、反応速度とレーザ強度は非線形な関 係になるため、図7(b)の結果と矛盾する。したがって、基板表 面などに自然に析出した数nm程度の銀ナノ粒子が、レーザ光を 吸収して反応に至るのではないかと考察できる。

光吸収後の反応過程としては吸収された光エネルギーが熱に なり反応が誘起される光熱反応過程と、光励起状態から電子移 動などが誘起される光化学反応過程に大別できる。しかし光熱 反応の場合、反応速度と照射光エネルギーは図7(b)のような線 形関係にならない。光化学的な反応として、ナノ粒子表面に吸 着したグルコースの酸化と硝酸銀の還元反応が、銀ナノ粒子の プラズモン励起を介して促進される反応過程が考えられるが、 詳細なメカニズムの解明は今後の課題である。

基板上に配列固定化した貴金属ナノ粒子集合体の優れた光機 能として、上述のように局在表面プラズモン共鳴によるナノ粒 子近傍での光電場増強があり、その応用の一つが吸着分子から の表面増強ラマン散乱測定である。そこで、形成された銀ナノ 粒子集合体が局在プラズモンによる電場増強効果を示すことを 確かめるため、ピリジン溶液(5.5 mM)およびローダミン6G 溶 液(2 µM)を滴下して表面増強ラマン散乱を測定した図8。 その結果、いずれの場合も高強度の表面増強ラマン散乱スペク トルが観測され、高い光電場増強能を有することが確かめられ た。



図 8 集光レーザで作製した銀ナノ粒子集合体に吸着した分子 からの表面増強ラマン散乱スペクトル (a) ピリジン (b) ローダ ミン 6G

5. 銀ナノ粒子集合体の局在表面プラズモン共鳴による 非線形ラマン散乱の増強

貴金属ナノ構造体による高い光電場増強は、非線形光学デバ イスや、非線形光学効果を利用した分子計測にも利用できる。 従来、このような非線形光学効果の誘起には、高い尖頭値強度 を有する短パルスレーザが利用されてきたが、貴金属ナノ構造 体による光電場増強は安価な連続発振レーザ照射による非線形 光学効果の誘起を実現できると期待されている。そこで、ボト ムアップレーザプロセッシングに必要不可欠な評価解析技術を 確立するため、基板上の銀ナノ粒子集合体に連続発振近赤外レ ーザ光を照射した際に生じる非線形光学効果であるハイパーレ イリー散乱やハイパーラマン散乱を測定し、局在表面プラズモ ンとの関係について詳細に解析した⁶。

クエン酸還元法で作製した銀コロイド溶液に、6.4 nM のロー ダミン66 と 10 nM の塩化ナトリウムを加え、ローダミン色素が 吸着した銀ナノ粒子凝集体を作製した。この凝集体を含むコロ イド溶液をカバーガラス状に滴下して、ガラス基板上に物理的 に吸着した単一の凝集体に対して測定を行った。図 9(A-E)は 3 ×10⁵ W/cm² の近赤外レーザを集光した時に得られる5つの異な る銀ナノ粒子凝集体からの発光スペクトルである。波長 532nm のピークは波長 1064nm の近赤外レーザ光のハイパーレイリー散 乱、波長 570nm 付近のいくつかのシャープなピークがローダミ ン分子のハイパーラマン散乱である。これらのシャープなピー クに加えて、粒子ごとに形状の異なるブロードな発光バンド(以 後バックグラウンド発光と呼ぶ)が観測されている。



図 9 異なる5つの銀ナノ粒子凝集体に吸着したローダミン 6G のハイパーラマン散乱スペクトル

凝集体 A はバックグラウンド発光が最も長波長側までスペクト ル成分をもち、B, C, D, E の順にその極大波長が短波長側に位置す る。またバックグラウンド発光が短波長側に現れる凝集体ほど、 ハイパーラマン散乱強度が弱いことが分かる。

図10は異なる4つの銀ナノ粒子凝集体のレイリー散乱スペク トル(A1 - D1)とハイパーラマン散乱スペクトル(A2 - D2) を測定した結果である。レイリー散乱スペクトルとは、顕微鏡 下で微粒子に対して白色光を暗視野照明した際に観測される散 乱光のスペクトルであり、銀ナノ粒子の場合、局在表面プラズ モン共鳴の波長依存性を表している。この測定結果から、プラ ズモン共鳴が長波長にある銀ナノ粒子凝集体ほどハイパーラマ ン散乱強度が高く、バックグラウンド発光の位置もプラズモン 共鳴に対応していることが分かった。

電場増強モデルに基づくと、ハイパーラマン散乱の増強因子は 以下の式で表される。

$$M_{total}(\lambda_L, \lambda_L/2 + \lambda_R) = \left| \frac{E^{Loc}(\lambda_L)}{E^{l}(\lambda_L)} \right|^4 \times \left| \frac{E^{Loc}(\lambda_L/2 + \lambda_R)}{E^{l}(\lambda_L/2 + \lambda_R)} \right|^2$$
$$= M_1(\lambda_L) \times M_2(\lambda_L/2 + \lambda_R)$$
(1)

ここで λ_L は入射光の波長(1064nm)、 λ_R はラマンシフト量、Eおよび $E^{L\alpha}$ は入射(輻射)光と銀ナノ粒子近傍での近接場光の 光電場を表す。すなわち両者の比 $E^{L\alpha}/E$ 」は、入射(輻射)光 が銀ナノ粒子近傍において何倍増強されるかを示す電場増強度 であり、ハイパーラマン散乱の増強度は入射光の波長における 増強度の4乗と、ラマン散乱光の波長における増強度の2乗に 比例する。電場増強は金属内自由電子が光と結合して励振され る表面プラズモン共鳴に由来し、電場増強因子 $E^{L\alpha}/E$ 」を波長 の関数で表すとプラズモン共鳴のスペクトル形状とよく一致す ると推測できる。実際に図10(A1-D1)のレイリー散乱スペクトル から求めた電場増強度の波長依存性を(1)式に代入し、ハイパー ラマン散乱強度やスペクトル形状の違いを実験的に再現するこ とに成功した図10(A3-D3)。



図 10 異なる4つの銀ナノ粒子凝集体のレイリー散乱スペクトル (A1-D1)、ハイパーラマン散乱スペクトル (A2-D2)、および 電場増強度の波長依存性 (A1-D1 破線)を元に求められたハイパ ーラマン散乱スペクトル (A3-D3)⁶

以上の結果は、高い電場増強に基づく非線形光学特性を示す 貴金属ナノ粒子集合体を作製するためには、入射場、すなわち 励起光が局在表面プラズモンと強く結合する必要があることを 示している。さらに貴金属ナノ構造のレイリー散乱スペクトル に現れる局在プラズモン特性から、電場増強度やその波長依存 性について解析できることも明らかにした。

6. さいごに

集光レーザ場に特有の光放射圧や局所的な光化学反応を利用 して、ガラス基板上に局在プラズモン特性を有する銀ナノ粒子 集合体を配列固定化するボトムアップレーザプロセッシング技 術の開発に取り組んだ。レンズの開口数を制御して、光散乱力 を利用することによって、光捕捉した銀ナノ粒子をガラス基板 上にパターニングすることに成功した。また、集光レーザによ る硝酸銀の還元反応を利用した、銀ナノ粒子集合体のパターニ ングも行い、ガラス基板上に形成したナノ構造体が高い光電場 増強能を有することを示した。これらの作製技術の開発と合わ せて、レイリー散乱スペクトル測定により基板上に形成された 貴金属ナノ構造の電場増強度や非線形光学特性を評価解析する 手法も提案した。

貴金属ナノ構造の持つ局在表面プラズモン特性を透明基板上 の任意の微小領域に付与できるボトムアップレーザプロセッシ ング技術は、フォトニック結晶やメタマテリアルなど最先端の 光科学分野はもちろん、超高感度バイオセンサーや高速光デバ イス、光エネルギー変換素子など次世代産業や安全・安心社会 の構築に貢献するナノテクノロジーとして期待できる。

謝辞

本研究にご助成いただきました、財団法人天田金属加工機械技 術振興財団に心より厚く御礼を申し上げます。また、共同研究 いただいた産業技術総合研究所伊藤民武博士に深く感謝申し 上げます。

参考文献

1) X.-M. Qian and S. M. Nie, Chemical Society Reviews, Vol.37, 912-920 (2008).

2) J. N. イスラエルアチヴィリ:分子間力と表面力,(1991) マグロウヒル出版.

3) Yoshito Tanaka, Hiroyuki Yoshikawa, Tamitake Itoh, Mitsuru Ishikawa, Optics Express, Vol.17, 18760-18767 (2009).

4) Erik J. Bjerneld, Fredrik Svedberg, Mikael Kall, Nano Letters, Vol.3, 593-596 (2003).

5) 吉川裕之, 広中孝行, 民谷栄一, 2010 年光化学討論会講演要旨 集, 333 (2010).

 Tamitake Itoh, Hiroyuki Yoshikawa, Kenichi Yoshida, Vasudevan Biju, and Mitsuru Ishikawa, Journal of Chemical Physics, Vol.133, 124704 (2010).